

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种多层薄膜的沉积装置

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

115

下载

0

收藏

0

**作者** 赵彦辉, 肖金泉, 郎文昌, 于宝海 and 华伟刚**发表日期** 2011-01-19**专利国别** 中国**专利类型** 实用新型**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本实用新型属于金属材料表面沉积超硬多层涂层技术领域,具体为一种钛/氮化钛多层薄膜的沉积装置。它是在同一个真空室中,通过交替通入不同气体,开启电弧蒸发源沉积超硬多层薄膜,可以实现多层薄膜厚度的精确控制。在该沉积装置通入氩气和氮气的管路上接有气体质量流量控制器、时间继电器和气体质量流量显示仪,气体质量流量控制器连接时间继电器,时间继电器连接气体质量流量显示仪。本实用新型解决了电弧离子镀沉积多层薄膜时采用手动控制气体流量而导致的多层中各单元层厚度不均匀的问题,采用气体质量流量控制器来实现氩气、氮气等多路气体的交替通入,从而保证单元层厚度的精确控制,以使沉积的超硬多层薄膜达到提高硬度和耐磨性的要求。

**公开日期** 2011-01-19**语种** 中文**专利申请号** CN201713572U**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/66748>] **专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所**推荐引用方式** 赵彦辉, 肖金泉, 郎文昌, 于宝海 and 华伟刚. 一种多层薄膜的沉积装置. 2011-01-19.**GB/T 7714**[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824  
号-8

甘公网安备 62010202001088号